

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-306847
 (43)Date of publication of application : 02.11.2000

(51)Int.Cl. H01L 21/205
 C23C 16/44
 H01L 21/324

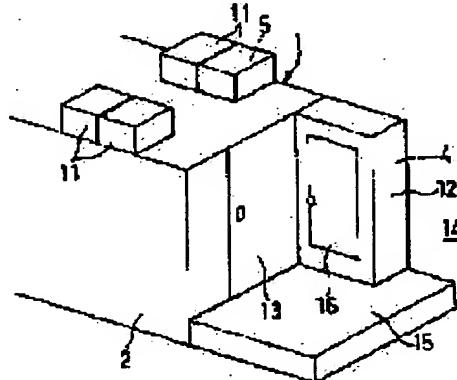
(21)Application number : 11-113817 (71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD
 (22)Date of filing : 21.04.1999 (72)Inventor : TAKANABE EIICHIRO
 TAKANASHI MORIHIRO

(54) TREATMENT APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve workability in inspection and the like of a gas feeding system.

SOLUTION: A treatment apparatus has a plurality of treatment units stored in a frame box 2. In a treatment step, a treatment gas is fed to each treatment unit via a pressure adjusting unit 4 and a flow-rate control unit 5 in a gas feeding system. A first storage box 11 for storing the flow-rate control unit 5 is provided at the upper part of the frame box 2, and a second storage box 12 for storing the pressure adjusting unit 4 as a whole is provided at a position, that is lower than the upper part of the frame box 2 and that facilitates working.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.03.2006
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number]
 [Date of registration]
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J-P) (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2000-306847

(P 2 0 0 0 - 3 0 6 8 4 7 A)

(43) 公開日 平成12年11月2日 (2000.11.2)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	マークド (参考)
H01L 21/205		H01L 21/205	4K030
C23C 16/44		C23C 16/44	D 5F045
H01L 21/324		H01L 21/324	F G

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全5頁)

(21) 出願番号	特願平11-113817	(71) 出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂5丁目3番6号
(22) 出願日	平成11年4月21日 (1999.4.21)	(72) 発明者	高鍋 英一郎 神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロン東北株式会社相模事業所内
		(72) 発明者	高梨 守弘 神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロン東北株式会社相模事業所内
		(74) 代理人	100093883 弁理士 金坂 憲幸
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】処理装置

(57) 【要約】

【課題】 ガス供給系における点検等の作業性の向上を図る。

【解決手段】 筐体2内に収容された複数の処理部3を備え、各処理部3にガス供給系の圧力調整部4および流量制御部5を介して処理ガス等のガスを供給して処理を行なう処理装置1において、前記流量制御部5を収容した第1の収容箱11を前記筐体2の上部に設置し、前記圧力調整部4をまとめて収容した第2の収容箱12を前記筐体2の上部よりも低い作業し易い場所に設置した。

